

# 特許協力条約

PCT

特許性に関する国際予備報告（特許協力条約第二章）

（法第 12 条、法施行規則第 56 条）  
〔PCT36 条及びPCT規則 70〕

REC'D 09 FEB 2006

WIPO

PCT

出願人又は代理人 の書類記号 2002121-PCT	今後の手続きについては、様式PCT/IPEA/416を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JP2004/004356	国際出願日 (日. 月. 年) 26. 03. 2004	優先日 (日. 月. 年)
国際特許分類 (IPC) Int.Cl. C23C14/34 (2006. 01)		
出願人 (氏名又は名称) 東北精機工業株式会社		

1. この報告書は、PCT35 条に基づきこの国際予備審査機関で作成された国際予備審査報告である。  
法施行規則第 57 条 (PCT36 条) の規定に従い送付する。
2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 3 ページからなる。
3. この報告には次の附属物件も添付されている。
- a. ☐ 附属書類は全部で ページである。
- ☐ 補正されて、この報告の基礎とされた及び／又はこの国際予備審査機関が認めた訂正を含む明細書、請求の範囲及び／又は図面の用紙 (PCT規則 70. 16 及び実施細則第 607 号参照)
- ☐ 第 I 欄 4. 及び補充欄に示したように、出願時における国際出願の開示の範囲を超えた補正を含むものとこの国際予備審査機関が認定した差替え用紙
- b. ☐ 電子媒体は全部で (電子媒体の種類、数を示す)。  
配列表に関する補充欄に示すように、電子形式による配列表又は配列表に関連するテーブルを含む。  
(実施細則第 802 号参照)

4. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。

- ☒ 第 I 欄 国際予備審査報告の基礎
- ☐ 第 II 欄 優先権
- ☐ 第 III 欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成
- ☐ 第 IV 欄 発明の単一性の欠如
- ☒ 第 V 欄 PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明
- ☐ 第 VI 欄 ある種の引用文献
- ☐ 第 VII 欄 国際出願の不備
- ☐ 第 VIII 欄 国際出願に対する意見

国際予備審査の請求書を受理した日  
26. 03. 2004

国際予備審査報告を作成した日  
30. 01. 2006

名称及びあて先  
日本国特許庁 (IPEA/JP)  
郵便番号 100-8915  
東京都千代田区霞が関三丁目 4 番 3 号

特許庁審査官 (権限のある職員)  
宮澤 尚之

4G 9278

電話番号 03-3581-1101 内線 3416

様式PCT/IPEA/409 (表紙) (2005年4月)

## 第I欄 報告の基礎

1. 言語に関し、この予備審査報告は以下のものを基礎とした。

- ☒ 出願時の言語による国際出願  
☐ 出願時の言語から次の目的のための言語である \_\_\_\_\_ 語に翻訳された、この国際出願の翻訳文
- ☐ 国際調査 (PCT規則12.3(a)及び23.1(b))  
☐ 国際公開 (PCT規則12.4(a))  
☐ 国際予備審査 (PCT規則55.2(a)又は55.3(a))

2. この報告は下記の出願書類を基礎とした。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に応答するために提出された差替え用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。)

☒ 出願時の国際出願書類

☐ 明細書

第 \_\_\_\_\_ ページ、出願時に提出されたもの  
第 \_\_\_\_\_ ページ\*、 \_\_\_\_\_ 付けで国際予備審査機関が受理したもの  
第 \_\_\_\_\_ ページ\*、 \_\_\_\_\_ 付けで国際予備審査機関が受理したもの

☐ 請求の範囲

第 \_\_\_\_\_ 項、出願時に提出されたもの  
第 \_\_\_\_\_ 項\*、PCT19条の規定に基づき補正されたもの  
第 \_\_\_\_\_ 項\*、 \_\_\_\_\_ 付けで国際予備審査機関が受理したもの  
第 \_\_\_\_\_ 項\*、 \_\_\_\_\_ 付けで国際予備審査機関が受理したもの

☐ 図面

第 \_\_\_\_\_ ページ/図、出願時に提出されたもの  
第 \_\_\_\_\_ ページ/図\*、 \_\_\_\_\_ 付けで国際予備審査機関が受理したもの  
第 \_\_\_\_\_ ページ/図\*、 \_\_\_\_\_ 付けで国際予備審査機関が受理したもの

☐ 配列表又は関連するテーブル

配列表に関する補充欄を参照すること。

3. ☐ 補正により、下記の書類が削除された。

☐ 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ  
☐ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項  
☐ 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図  
☐ 配列表 (具体的に記載すること) \_\_\_\_\_  
☐ 配列表に関連するテーブル (具体的に記載すること) \_\_\_\_\_

4. ☐ この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c))

☐ 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ  
☐ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項  
☐ 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図  
☐ 配列表 (具体的に記載すること) \_\_\_\_\_  
☐ 配列表に関連するテーブル (具体的に記載すること) \_\_\_\_\_

\* 4. に該当する場合、その用紙に "superseded" と記入されることがある。

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条（PCT35条(2)）に定める見解、  
それを裏付ける文献及び説明

## 1. 見解

新規性 (N)	請求の範囲 2-12	有
	請求の範囲 1	無
進歩性 (I S)	請求の範囲 2, 6-12	有
	請求の範囲 1, 3-5	無
産業上の利用可能性 (I A)	請求の範囲 1-12	有
	請求の範囲	無

## 2. 文献及び説明 (PCT規則 70.7)

文献1:JP 2000-45072 A (株式会社小松製作所) 2000.02.15

文献2:JP 8-78337 A (富士通株式会社) 1996.03.22

文献3:JP 7-75689 B2 (富士通株式会社) 1995.08.16

文献4:C.B.EOM et al, In-situ grown YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-d</sub> thin films from single-target magnetron sputtering, APPL.PHYS.LETT., 1989.08.7, vol.55. no.6, p.595-597

(1)請求の範囲1に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1及び2から新規性を有さない。文献1の[0031]～[0032]および図 8 には、基板の主面の延長方向で微粒子状の薄膜材料を生成し、生成した微粒子状の薄膜材料を基板の第1の主面及び第2の主面に導く薄膜形成方法が記載されている。

(2)請求の範囲3および4に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1および文献2より進歩性を有しない。文献1には、主面の法線方向を回転軸として回転させること、および、基板の第1の主面上及び第2の主面上にヒータを配置して基板を加熱することが開示されていない。しかしながら、本願発明と文献2記載の発明は、いずれも堆積速度を一樣にすることを課題とし、同様の技術手段を採用したものである。よって、当該文献2に記載されている主面の法線方向を回転軸として回転させるという技術手段、および基板の第1の主面上および第2の主面上にヒータを配置して基板を加熱するという技術手段を文献1記載発明に適用することは、当業者であれば容易に想到し得たものである。

(3)請求の範囲5に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1ないし文献3より進歩性を有しない。プラズマジェット法により酸化物超伝導膜を形成することは、文献3に記載されているように周知の技術手段であり、上記文献1に記載されたプラズマジェット法により、酸化物超伝導体を形成することに格別の創意を要したものとは認められない。

(4)請求の範囲2および6～12に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献に対して進歩性を有する。上記各文献1には、微粒子状の薄膜材料を収斂して密度が高くなるように導くことや、基板の第1の主面上および第2の主面上にガイドを設けることが記載されており、しかもその点は当業者といえども容易に想到し得ないものである。